



一种结构紧凑的多功能磁控离子镀弧源装置

文献类型: 专利

作者 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 官骏, 赵彦辉, 杨英 and 闻立时

发表日期 2009-02-04

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及薄膜制备领域,具体地说是一种结构简单紧凑的多功能多控制模式磁控离子镀弧源装置,磁控离子镀弧源装置的靶材底座后面设有由小型直流电机或者交流电机驱动的旋转磁场发生装置,电机驱动固定在电机转轴上的磁轭带,动合理分布在磁轭上的永磁体转动,不同的永磁体分布便产生不同位形结构的旋转磁场,实现多控制模式的目的。本发明利用简单紧凑的弧源结构和不同的永磁体分布方式,产生不同位形的动态旋转磁场,用以改善弧斑的放电形式,控制弧斑的运动轨迹,提高靶材利用率和刻蚀均匀性,减少或抑制靶材大颗粒的发射,用以制备高质量的薄膜,达到在一个弧源装置上实...

公开日期 2009-02-04

语种 中文

专利申请号 CN101358330

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/67052>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 肖金泉, 郎文昌, 孙超, 官骏, 赵彦辉, 杨英 and 闻立时. 一种结构紧凑的多功能磁控离子镀弧源装置. 2009-02-04. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
76	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

